Вестник московского университета

№ 5-1974

УДК 539:293.535

эль дессуки

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАСЕЛЕННОСТИ УРОВНЕЙ

Интерферическим методом и методом зондов исследована заселенность атомных уровней неона в чистом неоне и в гелий-неоновой смеси. Получены данные о заселенности ряда уровней неона в зависимости от тока разряда, давления, примеси гелия и электронной температуры. Обнаружено значительное влияние отрицательной дисперсии на заселенность уровней неона.

Явление отрицательной дисперсии [1—4], которая возникает при прохождении света через возбужденное вещество, представляет очень большой интерес как для изучения процессов, связанных с квантовыми переходами, так и для определения соответствующих сил осцилляторов. Исследования аномальной дисперсии в возбужденных газах проводились многими авторами [5—9], но они, как обычно, пренебрегали отрицательной дисперсией.

В настоящей работе измерены заселенность каждого уровня 2p⁵3sx и 2p⁵3py неона по методу крюков Рождественского с учетом отрицательной дисперсии и относительной интенсивности эмиссионных спектральных линий, а также по электрическим измерениям.

Спектроскопические измерения

Относительная интенсивность спектральных линий и заселенность уровней измеряется с помощью следующего отношения:

$$\frac{N_k}{N_n} = \frac{I_{km}}{I_{nm}} \frac{\lambda_{km} A_{nm}}{\lambda_{nm} A_{km}},\tag{1}$$

где I_{km}/I_{nm} — относительная интенсивность спектральных линий, N_k и N_n — концентрации возбужденных атомов на верхнем уровне k и на верхнем уровне n; индексом m обозначен нижний уровень. Число дисперсионных центров $R\Delta_{mn}$ и заселенность уровней определяются пометоду крюков путем измерения расстояния между вершинами крюков $(2\Delta_{mn})$, расположенными по обе стороны от линии поглощения λ_{mn} (рис. 1). Величина R вычислена по формуле

$$R = f_{m_n} N_n \left(1 - \frac{g_m N_n}{g_n N_m} \right) = \frac{\pi m_0 c^2 K_{mn}}{L c^2 \lambda_{mn}^3} (2\Delta_{mn})^2, \tag{2}$$

где m_0 и e — масса и заряд электрона, f_{mn} — сила осциллятора для перехода $m \rightarrow n$, g_m и g_n — статические веса верхнего и нижнего уровней, L — длина положительного столба разряда.

Для того чтобы изменить величину k_{mn} , достаточно сфотографировать наклонные интерференционные полосы, получающиеся в спектрографе при введении в интерферометр компенсационной пластинки, и измерить число полос x, укладывающихся в интервале $\Delta\lambda$, посредине которого находится λ_{mn} .

Тогда

$$k_{mn} = \frac{x\lambda_{mn}}{\Delta\lambda}.$$
 (3)

Для k и n уровней уравнение (2) может быть записано в виде

$$\frac{R_{km}}{f_{mk}} = (N_m - \beta_1 N_k) = \alpha_1, \tag{4}$$

$$\frac{R_{nm}}{f_{mn}} = (N_m - \beta_2 N_n) = \alpha_2, \qquad (4')$$

где

$$\beta_1 = \frac{g_m}{g_k}$$
 is $\beta_2 = \frac{g_m}{g_n}$.

Отсюда имеем

$$\frac{(\alpha_1 - \alpha_2)}{N_n} = \beta_2 - \beta_1 \frac{N_k}{N_n}.$$
 (5)

Из формул (1) и (5) можно определить абсолютную заселенность уровней N_h , N_n и N_m с учетом отрицательной дисперсии. Для того чтобы сделать более уверенно интерпретацию полученных экспериментальных результатов, наряду со спектроскопическими измерениями проводились измерения электронной температуры по методу зондов.

Исследования оптико-спектральных характеристик положительного столба разряда в неоне и в смеси гелия и неона проводились в разрядной трубке диаметром 4 мм и длиной 100 см. Длина положительного столба разряда была 91 см. Измерения велись в видимой (краснойжелтой) части спектра. Как уже сказано, заселенность верхних и нижних уровней неона $2p^53sx$ и $2p^53py$ находилась по интерферометрическому методу (метод крюков) и относительной интенсивности спектральных линий. При вычислении концентрации возбужденных атомов мы пользовались значениями сил осцилляторов, приводимыми в работе [10].

Все оптические измерения выполнялись с помощью двухлучевого интерферометра Майкельсона, скрещенного со спектрографом ИСП-51, с автоколлимационной камерой УФ-85. Величина обратной дисперсии спектрографа равнялась 9,3 Å/мм в красной области спектра. Относительная интенсивность спектральных линий измерялась микрофотометрическим методом.

Для освещения интерферометра использовался импульсный источник белого света большой яркости. Источник представляет собой искро-



Рис. 1. Фотография крюков около линии неона

вой разряд между электродами специальной формы. Один электрод был медный ($\phi = 50 \, \text{мм}$) в виде пластинки с узким круглым отверстием, второй — железный в виде стержня с коническим концом. Оба электрода были смонтированы в специальном держателе. Питание разряда осуществлялось от высоковольтного конденсатора большой емкости. Зажигание разряда производилось принудительным образом с помощью дополнительного разряда. Возникающие при разряде возбужденные пары металла электродов и сильно нагретый воздух выбрасываются из отверстия медного электрода в виде быстрой струи плазмы, дающей исключительно яркий свет, имеющий сплошной спектр.



Рис. 2. Зависимость электронной температуры T_e газа Ne и смеси He+Ne от разрядного тока: 1 - Ne=2,5; 2 - Ne=5; 3 - смесь 2,3и 4 - смесь 8,6 мм рт. ст.



Рис. 3. Зависимость заселенности верхних уровней неона (Ne—p= =5 *мм рт. ст.*) $2p^53py$ от разрядного тока в смеси Ne+He: $1 - (p_3)^3p_1$, $2 - (p_4)^3p_2$, $3 - (p_5)^1p_1$, $4 - (p_6)^1D_2$

Параллельно с оптическими измерениями в тех же условиях разряда методом зондов измерялась электронная температура T_e разряда. Для этого в трубку впаивался молибденовый зонд диаметром 0,1 *мм*, длиной 2 *мм*, зонд располагается в центре трубки по ее оси. Электронная температура находилась из зондовой характеристики [11, 12]. Электронная температура T_e измерялась для разных токов разряда, разных давлений и разных смесей. Результаты измерения приведены на рис. 2. С увеличением давления газа или тока разряда электронная температура T_e падает как в чистом неоне, так и в смеси гелия и неона. Добавление гелия к неону уменьшает электронную температуру разряда. Эти результаты хорошо согласуются с результатами других авторов [13].

Измерение концентрации возбужденных атомов

Результаты измерения концентрации возбужденных атомов неона на уровнях $2p^53sx$ и $2p^53py$ в чистом неоне и в смеси гелия и неона приведены на рис. 3—5 и в таблицах.

Величина $\left(\frac{g_m}{g_n} \cdot \frac{N_n}{N_m}\right)$ на уровнях $2p^5 3py$ неона не является малой. Во многих случаях она равна половине или больше половины. На рис. 3 и 4 приведены зависимости концентрации возбужденных атомов на верхних уровнях неона в зависимости от силы разрядного тока и давления газа. Концентрация атомов на уровнях ${}^{3}p_{1}$, ${}^{4}p_{1}$ и ${}^{4}D_{2}$ увеличивается в два раза и больше с увеличением давления от 2,5 до 5 *мм рт. ст.* Но концентрация атомов на уровне ${}^{3}p_{2}$ (нижний уровень генерации неона $3S_{2}$ — $2p_{4}$, λ =6328 Å и $2S_{2}$ — $2p_{4}$, λ =11523 Å) уменьшается на половину с увеличением давления неона. При добавлении гелия (p= =8,6 *мм рт. ст.*) при постоянном отношении в смеси концентрации воз-

> N-10-11 100-





Рис. 4. Зависимость заселенности верхних уровней неона $2p^{5}3py$ от разрядного тока в чистом неоне (Ne—He—p=4,3 мм pr. cr.): 1 — $(p_2)^3p_1, 2 - (p_4)^3p_2, 3 - (p_5)^1p_1, 4 - (p_6)^1D_2$



бужденных атомов на уровнях ³p₁, ³p₂, ¹p₁ и ¹D₂ уменьшаются больше, чем в два раза по сравнению с чистым неоном при давлении р=5 мм рт. ст. Если отношение смеси гелия к неону постоянно, но общая плотность смеси увеличивается (р от 4,3 до 8,6 мм рт. ст.), то заселенность уровней уменьшается. Особенно падает заселенность уровня ³р₂. Ha рис. 5 показана зависимость от силы тока в чистом неоне и концентрация возбужденных атомов на нижних уровнях неона. С увеличением давления неона от 2,5 до 5 мм рт. ст. заселенность метастабильных уровней ${}^{3}p_{0}^{0}$ и ${}^{3}p_{2}^{0}$ увеличивается, в то время как заселенность резонансного уровня ³p₁ уменьшается. При добавлении гелия к неону (p ==4,3 мм рт. ст.) заселенность всех уровней ³p₀⁰, ³p₁⁰ и ³p₂⁰ увеличивается. При большем давлении смеси (р=8,6 мм рт. ст.), но при сохранении концентраций гелия и неона концентрация атомов на метастабильных уровнях ³ p₀⁰ и ³ p₂⁰ уменьшается по сравнению с чистым неоном при давлении p=5 мм рт. ст. Заселенность резонансного уровня ${}^{3}p_{1}^{0}$ при этом мало изменяется. При увеличении плотности смеси от 4,3 до 8,6 мм рт. ст. концентрация атомов на уровнях ³p₀⁰, ³p₁⁰ и ³p₂⁰ уменьшается по сравнению с таковой при давлении смеси p=4,3 мм pr. ст.

Обсуждение результатов

При стационарности процесса заселенность каждого уровня определяется из условия равенства числа актов возбуждения числу атомов разрушения в единицу времени [14]. Заселение уровней происходит в основном за счет прямого и ступенчатого возбуждения при соударениях 1-го рода с электронами, переходов между уровнями за счет соударений 2-го рода с атомами, спонтанных переходов с более высоких уровней поглощения излучения.

Разрушение уровней в основном происходит за счет спонтанного излучения, перехода на более высокие уровни при соударениях 1-го рода с электронами, перехода между уровнями за счет соударений 2-го рода с электронами и атомами, тройных столкновений и столкновений со стенками. При увеличении давления происходит сильное изменение распределения электронов по скоростям, что эквивалентно соответствующему изменению электронной температуры T_e , которая падает с ростом давления (см. рис. 2). При этом на кривых, изображающих заселенность уровней энергии атомов неона, обнаруживаются хорошо выраженные максимумы при возрастании давления (см. рис. 3). Как показано в работе [15], в полном соответствии с диффузионной теорией положительного столба газового разряда, наличие гелия в гелий-неоновой смеси приводит к увеличению градиента потенциала, вследствие чего возрастает средняя электронов и, следовательно, вероятность

Габлиц	a l	
--------	-----	--

	<i>p</i> =5 мм pm. cm.												
Уровень, 2 <i>р</i> ⁵ 3ру	Ток, ма												
	29	40	58	68	83	96	32	43	56	66	77	87	95
	1,9 2,5 9,2 1,4 9,2 2,5 8,4 2,6	12,8 3,8 13,0 9,0 16,6 10,0 17,4 5,9	33,0 4,9 19,5 25,8 6,3 27,5 21,9 7,3	19,0 7,9 30,1 15,6 5,6 13,8 18,9 6,2	18,1 4,7 17,0 12,3 3,9 1,9 9,7 3,1	6,7 4,3 4,6 1,6 9,8	0,8 3,8 2,3 0,5 10,4 2,3 9,4 3,1	20,4 0,7 3,9 14,2 13,4 3,2 17,6 5,0	23,11,52,218,87,12,421,16,8	63,1 0,9 8,0 50,5 29,3 0,7 25,5 8,7	46,3 2,6 6,2 33,8 21,0 2,1 25,3 8,2	31,7 1,9 4,0 24,4 2,0 0,4 25,3 9,9	38,6 0,3 7,9 26,6 25,6 0,4 25,1 8,3

N.10-11, CM-3

Таблица 2

p=4,3 мм pm. cm.									р=8,6 мм рт. ст.							
Уровень, 2 <i>р</i> ⁵ 3ру	Ток, ма															
	28	39	52	61	74	86	98	32	41	52	59	72	81	96		
$\begin{array}{c} {}^{3}p_{1} (p_{2}) \\ {}^{3}p_{0} (p_{3}) \\ {}^{3}p_{2} (p_{4}) \\ {}^{1}p_{1} (p_{5}) \\ {}^{1}D_{2} (p_{6}) \\ {}^{3}D_{1} (p_{7}) \\ {}^{3}D_{2} (p_{8}) \\ {}^{3}D_{3} (p_{9}) \end{array}$	28,0 13,6 51,1 20,0 0,5 3,9 6,4 2,1	36,8 13,4 48,9 25,3 19,9 1,3 19,4 5,6	18,5 18,7 24,4 2,6 10,0 1,1 8,5 2,8	24,8 6,6 25,0 15,8 10,6 1,1 8,9 2,8	20,2 5,0 20,3 12,7 5,3 3,1 17,7 5,8	21,5 5,3 20,2 14,9 3,1 1,7 12,8 3,9	27,6 8,0 29,5 21,1 4,1 3,4 11,2 3,5	$14,7 \\ 5,7 \\ 0,1 \\ 11,0 \\ 1,9 \\ 5,9 \\ 25,9 \\ 8,6$	26,2 1,0 3,7 18,5 12,5 3,1 21,3 7,4	21,4 3,3 3,4 17,4 11,7 4,1 17,6 5,9	7,5 1,9 0,7 5,7 2,2 7,4 13,2 4,6	8,2 0,8 1,4 4,0 4,6 4,3 13,7 4,8	1,3 0,4 1,4 0,9 4,9 3,0 3,7 1,1	1,0 0,6 3,3 0.7 11,0 2,6 0,8 0,3		

Смесь гелия и неона (процент гелия в смеси равен 42%), N·10-11, см-3

прямого и ступенчатого возбуждения энергетических уровней Не и Ne электронным ударом. Это иллюстрируют данные рис. 4. Уменьшение концентрации возбужденных атомов неона при давлении смеси

 $p = 8,6 \text{ мм рт. ст. по сравнению с чистым неоном при давлении <math>p = 5 \text{ мм}$ рт. ст. может происходить благодаря отклонению распределения электронов по энергиям от максвелловского, а также изменения плотности газа и электронной температуры [16, 17], при увеличении давления (p > 5 MM pT cT.)

Поведение уровня $2p^{5}3p^{-3}p_{2}(p_{4})$ существенно отличается от поведения других уровней. Это объясняется тем, что уровень р4 является нижним уровнем для переходов 3S-2p4 и 2S2-2p4, на которых возникают генерации на длинных волнах 6328 Å и 11523 Å. Естественно ожидать, что и при отсутствии генерации стимулированные переходы будут способствовать заселению уровня 2p4, если уровни 3S2 и 2S2 будут сильно заселяться, что и происходит при добавлении гелия. Сказанное иллюстрируется данными рис. 4. Разумеется этот фактор имеет решающий перевес только в определенных условиях давлений и токов.

Проведенные исследования показали, что влияние отрицательной дисперсии при измерениях заселенности уровней неона 2p53py не является малым и им нельзя пренебрегать. Это позволяет утверждать, что при исследованиях заселенностей уровней и сил осцилляторов оптическими методами в возбужденных газах и парах влияние индуцированных радиационных эффектов должно приниматься во внимание, если желают получить прецизионные результаты.

В заключение автор приносит сердечную благодарность проф. Ф. А. Королеву за неизменное внимание к работе, обсуждение результатов и ценные замечания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ladenburg R. Zeits für Phys., 48, 15, 1928.

2. Ladenburg R., Koplerman H. Zeits für Phys., 48, 26, 1928. 3. Ladenburg R., Koplerman H. Zeits für Phys., 48, 26, 1928. 4. Ladenburg R., Koplerman H. Zeits für Phys., 48, 51, 1928. 5. Пеккин Н. П., «Оптика и спектроскопия», 2, 545, 1957.

5. Пеккин п. п. «Оптика и спектроскопия», 2, 345, 1557. 6. Шухтин А. М. «Оптика и спектроскопия», 7, 838, 1959; 10, 436, 1961. 7. Шухтин А. М., Егоров В. С. «Вестн. Ленингр. ун-та», № 16, 61, 1959. 8. Егоров В. С., Козлов Ю. Г., Шухтин А. М. «Оптика и спектроскопия», 15, 6, 839, 1963. 9. Егоров В. С., Козлов Ю. Г., Шухтин А. М. «Оптика и спектроскопия»,

17, 154, 1964. 10. Wiese W. L., Smith M. W., Glennon B. M. Atomic transotion probabilities,

Wiese W. L., Smith M. W., Glennon B. M. Atomic transotion probabilities, vol. I, NBS, Washington, 1966.
Захарова В. М., Каган Ю. М. «Оптика и спектроскопия», 1, 627, 1956.
Козлов О. В. Электрический зонд в плазме. М., 1969.
Young R. T., Willbtt C. S., Maupin R. T. J. Appl. Phys., 41, 2936, 1970.
Фриш С. Э. «Успехи физических наук», 61, 461, 1957.
Francis G. Handbuch Physik, 22, Berlin, 1956.
Golubowsky Ju. B., Kagan Ju. M., Michel P., Nesterowa L. L. Beitr plasmaphys, 9, 217, 1969.
Golubowsky Ju. B. Kagan Ju. M. Liagustschenko R. J. Michel P.

Golubowsky Ju, B., Kagan Ju. M., Ljagustschenko R. J., Michel P. Beitr plasmaphys., 10, 265, 1970.

Поступила в редакцию 8.9 1972 г.

Кафедра электроники